# SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTER

Patent Number:

JP3183032

Publication date:

1991-08-09

Inventor(s):

MAEI SHIGEKI; others: 01

Applicant(s):

SHARP CORP

Requested Patent:

□ JP3183032

Application Number: JP19890324501 19891212

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B7/125; G02B5/30; H01S3/101; H01S3/18

EC Classification:

Equivalents:

# Abstract

PURPOSE:To improve an S/N even when reading stored information from a recording carrier with a low light emitting output by providing plural laser chips, each different in reflectance on a laser emitting surface, and a hologram diffraction grating.

CONSTITUTION: A laser beam, which is emitted from a semiconductor laser chip 11 for write at a high output, is made incident to a hologram diffraction grating 13. The 0th order beam transmitted through a hologram 13a is made incident to a recording carrier 17 and data are written into the carrier 17. Next, the laser beam emitted from a semiconductor laser chip 12 for read at a low output is made incident to the carrier 17. The 1st beam diffracted by the hologram 13a is made incident to the carrier 17. In the case of such operation, since the reflectance on the laser emitting surface of the chip 12 is made higher than the reflectance on the laser emitting surface of the chip 11, the returned beam to be reflected by the carrier 17 and to arrive at the chip 12 scarcely go into the internal part of the laser chip. Therefore, even when the light emitting output of the chip 12 is low, the data can be read out with high S/N.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-183032

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)8月9日

G 11 B 7/125 G 02 B 5/30 H 01 S 3/101 3/18 A 8947-5D 7448-2H 7630-5F 6940-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

半導体発光装置

②特 願 平1-324501

②出 願 平1(1989)12月12日

@発明者前

茂 樹

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社

内

伽発 明 者 大 塚

尚孝

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社

内

勿出 顋 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

邳代 理 人 弁理士 青山 葆 外1名

井

## 明知自治

1. 発明の名称

半導体発光装置

- 2.特許請求の範囲
- (1) 異なる位置に配され、レーザ出射面の反射 率が異なる複数のレーザチップと、

上記複数のレーザチップから異なる光路で入射 されたレーザ光を対象物へ向けて同一光路で出射 するホログラム回折格子を備えたことを特徴とす る半導体発光装置。

3. 発明の詳細な説明

〈産業上の利用分野〉

この発明は、光ピックアップに使用される半専 体発光装置に関する。

〈従来の技術〉

従来、光ピックアップは一般に第2図に示すように構成されている。この光ピックアップは1つの半導体レーザチップ21と、ビームスプリッタ22と、コリメートレンズ23と、対物レンズ24と、受光案子26を備えている。レーザチップ

21が出力したレーザ光は、ビームスブリッタ2 2.コリメートレンズ23、対物レンズ24、を **通過して記録担体25に入射する。そして、記録** 担体25上への音き込みを行い、または、記録担 体25の紀録情報によって変調を受ける(読み出 し)。その後、記録担体25によってレーザ光は 反射され、再び対物レンズ24,コリメートレン ズ23を辺過してビームスプリッタ22に入射し、 さらに、このビームスプリッタ22によって反射 されて受光索子26に入射する。受光案子26が このレーザ光を受けて出力する信号に基づいて、 図示しない処理回路によって記録担体25のトラッ クを正確に追跡するためのサーボ信号や上記記録 情報の内容を表わす再生信号(RF信号)を得るよ うになっている。上記記録担体25への音き込み を行う場合、半導体レーザチップ21の発光出力 を高くして強いレーザ光を照射して行う一方、記 録担体25から記録悄根を読み出す場合、半草体 レーザチップ21の発光出力を低くして弱いレー **ザ光を照射して行っている。そして、音き込みの** 

時に、半導体レーザチップ21を高出力で発光させるために、第3図に示すように、半導体レーザチップ21の前面(レーザ出射面)20側にAR(アンチ・リフレクション)コート31を施して反射率を低くする一方、後面30側に高反射コート32を施して反射率を高くし、これによって発光出力が高くなるようにしている。

# <発明が解決しようとする課題>

ところで、上記記録担体25によって反射され、対物レンズ24、コリメートレンズ23を通過してビームスブリッタ22に入射したレーザ光は、その一部がビームスブリッタ22を通過して、いわゆる戻り光としてレーザチップ21に入射する。一般に知られているように、レーザチップ21は、この戻り光によって励起され、発光出力が変動する。ここで、上記半導体レーザチップ21は、前面(レーザ出射面)31側の反射率を低くしている。ために発光は大きを入射するので、誘起される出力変動(雑音)が大きくなっている。このため、低発光出力で記録担体

ラム回折格子はこのレーザ光を回折またはそのま ま透過させて、対象物へ向けて所定の光路で出射 する。したがって、従来と同様に、上記反射率が 低いレーザチップによって発光出力を高くして、 強いレーザ光でもって貸き込みすることが可能と なる。一方、記録担体から記憶情報の読み出しを 行う場合、上記異なる位置に配された複数のレー ザチップのうちレーザ出射面の反射率が高い方の レーザチップから上記ホログラム回折格子へ向け てレーザ光を出射する。上記回折格子はこのレー ザ光を回折またはそのまま透過させて、上記対象 物へ向けて背き込みの際の光路と同一の光路で出 射する。このとき、反射率が高い方のレーザチッ プを使用しているため、上記対象物に反射されて このレーザチップに到達する戻り光は、レーザチッ プ内部にあまり侵入しなくなる。したがって、レ ーザチップの発光出力が低くても高いS/N比で 読み出しが可能となる。

#### 〈実施例〉

以下、この発明の半導体発光装置を実施例によ

2 5 から記憶情報の読み出しを行う時に、上記戻り光による戻り光雑音により、S / N 比が劣化するという問題がある。

そこで、この発明の目的は、光ピックアップの 音き込み用の高出力光顔として使用することができ、また、低発光出力で記憶担体から記憶情報の 読み出しを行う場合にもS/N比を高くできる半 導体発光装置を提供することにある。

## 〈課題を解決するための手段〉

上記目的を達成するために、この発明の半導体 発光装置は、異なる位置に配され、レーザ出射面 の反射率が異なる複数のレーザチップと、上記複 数のレーザチップから異なる光路で入射されたレ ーザ光を対象物へ向けて同一光路で出射するホロ グラム回折格子を備えたことを特徴としている。

#### 〈作用〉

記録担体への音き込みを行う場合、異なる位置 に配された複数のレーザチップのうちレーザ出射 面の反射率が低い方のレーザチップからレーザ光 をホログラム回折格子へ向けて出射する。ホログ

## り詳細に説明する。

第1図はこの発明の一実施例の半導体発光装置 10を使用して光ピックアップを構成した例を示 している。この光ピックアップは、半導体発光装 置10の他に、第2図に示した従来の光ピックアッ プと同様に、ビームスプリッタ14と、コリメー トレンズ15と、対物レンズ16と、受光案子1 8を惚えている。上記半導体発光装置10は、異 なる位置に配された音き込み用半導体レーザチッ プ11および読み出し用レーザチップ12と、ホ ログラム回折格子13とからなっている。曺き込 み用半導体レーザチップ11は、第3図に示した 半事体レーザチップ21と同一の構造からなって いる。すなわち、チップの前面20側にARコー ト31を施して反射率を低くする一方、チップの 後面30側に髙反射コート32を施して反射率を 髙くしている。このようにして発光出力が髙くな るようにしている。読み出し用レーザチップ21 は、第4図に示すように、前面(レーザ出射面)40 と後面50にそれぞれ半波艮(1/2)コーティン

グ41.41を施して、前面40側の反射率を音き込み用半導体レーザチップ11の前面20側の反射率よりも高くしている。ホログラム回折格子13は音き込み用半導体レーザチップ11と読み出し用半導体レーザチップ12とからのレーザ光の干渉パターンにより形成されたホログラム13aを備えている。そして、音き込み用半導体レーザチップ11の出射光がこのホログラム13aをそのまま透過した0次光と、読み出し用半導体レーザの出射光がホログラム13aにより回折された1次光とが同じ光路を適るようになっている。

まず、記録担体 1 7 (第 1 図に示す)への音き込みの動作を説明する。音き込み用半導体レーザチップ 1 1 が高出力で出射したレーザ光は、ホログラム回折格子 1 3 に入射する。ホログラム 1 3 aをそのまま透過した 0 次光は、ビームスブリック 1 4、コリメートレンズ 1 5、対物レンズ 1 6を順次通過した後、記録担体 1 7 に入射して、従来と同様に、記録担体 1 7 によって反射され、そのレーザ光は記録担体 1 7 によって反射され、その

このように助作する場合、 音き込み用レーザチップ11のレーザ出射面20の反射率よりも読み出し用レーザチップ12のレーザ出射面40の反射 率を高くしているため、記録担体17に反射されてこのレーザチップ12に到違する戻り光は、レーザチップ内部にあまり侵入しなくなる。したがって、読み出し用レーザチップ12の発光出力が低くても、高いS/N比で読み出しを行うことができる。

#### 〈発明の効果〉

以上より明らかなように、この発明の半球体発 光装置は、異なる位置に配され、レーザ出射面の 反射率が異なる複数のレーザチップと、上記複数 のレーザチップから異なる光路で入射されたレー ザ光を対象物へ向けて同一光路で出射するホロケ ラム回折格子を備えているので、レーザ出射面の 反射率が低いレーザチップを高発光出力を必要 する音き込みに使用できる一方、レーザ出射の 反射率が高いレーザチップを、低発光出力で助作 させて読み出しに用いて、記憶担体から記憶惰報 反射光は再び対物レンズ16.コリメートレンズ 15を通過した後、ビームスプリッタ14で分岐 されて、受光索子18に入射する。そして受光案 子18の出力信号から、図示しない処理回路によっ てサーボ信号が得られる。

次に、読み取りの動作を説明する。読み出し用 半導体レーザチップ12から低出力で出射したレーザ光は、上記音き込み用半導体レーザチップ11 1が出射したレーザ光と異なる光路でホログラム 回折格子13に入射する。ホログラム13aにより回折格子13に入射する。ホログラム13aにより回折された1次光が上記音き込みの際のののアプリー光路で出射する。そしてビームスズ16を超次によって変調を受けて、記録担体17に入射する。記録は、本の反射光は、再び対物レンズ16、コリッタ14での反射光は、再び対物レンズ16、コリッタ14で分岐されて、受光案子18の出力信号から、図示しない処理回路によって再生信号およびサーポ信号が得られる。

の読み出しを行う場合に戻り光の影切を少なくして、S/N比を高くすることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例の半導体発光装置を設けて相成した光ピックアップを示す図、第2図は従来の光ピックアップを示す図、第3図は上記従来の光ピックアップの半導体レーザチップの構造を示す図、第4図は上記半導体発光装置の読み出し用半導体レーザチップの構造を示す図である。

- 10…半導体発光装置、
- 12…読み出し用半導体レーザチップ、
- 13…ホログラム回折格子、
- 13a…ホログラム、
- 14,22…ビームスプリッタ、
- 15,23…コリメートレンズ、
- 16,24…対物レンズ、17,25…記録担体、
- 18.26…受光案子、
- 20.40…レーザ出射面、30.50…後面、

31…ARコーティング、

32…高反射コーティング、

41… 1/2コーティング。

特 許 出 願 人 シャープ株式会社 代 理 人 弁理士 青 山 葆ほか1名



